



SUOMI – FINLAND (FI)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan **20000677**

(51) Kv.lk.7 - Int.kl.7

C07C 309/65, 309/66, 309/73, 309/74, 381/00,
251/62, G03F 7/004

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **23.03.2000**

(24) Alkupäivä - Löpdag **23.03.2000**

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **30.09.2000**

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

31.03.1999 EP 99810273 P 07.04.1999 EP 99810287

30.08.1999 EP 99810779

(71) Hakija - Sökande

1 •Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SVEITSI, (CH)

(72) Keksijä - Uppfinnare

- 1 •Asakura,Toshikage**, 4-8-1-102, Minoo-shi, Osaka 562-0001, JAPANI, (JP)
- 2 •Yamato,Hitoshi**, 5-2-22-201, Nakayamasatsukidai, Takarazuka-shi, Hyogo 665-0871, JAPANI, (JP)
- 3 •Ohwa,Masaki**, 1-1-4, Kotoku-cho, Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo 657-0025, JAPANI, (JP)
- 4 •Birbaum,Jean-Luc**, Bruderholzstrasse 17, 4102 Binningen, SVEITSI, (CH)
- 5 •Dietliker,Kurt**, Baselmattweg 132, 4123 Allschwil, SVEITSI, (CH)
- 6 •Tanabe,Junichi**, 28-32, Izumi-cho, Takarazuka-shi, Hyogo 665-0864, JAPANI, (JP)

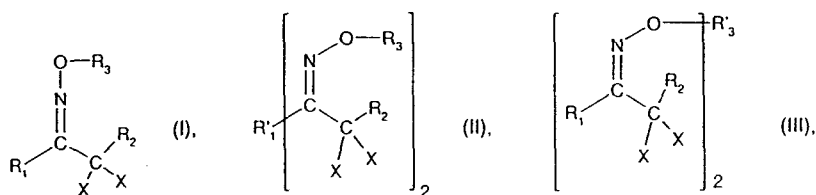
(74) Asiamies - Ombud: Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab
Iso Roobertinkatu 4 - 6 A, 00120 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Oksiimijohdannaiset ja niiden käyttö latenteina happoina
Oximderivat och deras användning som latenta syror

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Kemiallisesti vahvistetuissa estopinnoitevalmisteissa
valoherkkinä happodonoreina erityisesti sopivia ovat kaa-
van I, II ja III mukaiset yhdisteet



joissa R₁ on esimerkiksi vety, C₁-C₁₂-alkyyli, C₃-C₃₀-syk-
loalkyyli, C₁-C₁₂-alkenyli, C₁-C₆-sykloalkenyli, fenyli,
joka on substituimaton tai substituoitu, naftyyli, ant-
rasyli tai fenantryli, joka on substituimaton tai
substituoitu, heteroaryyliradikaali, joka on substituoi-
maton tai substituoitu, jolloin kaikki radikaalit R₁,
vetyä lukuunottamatta, voivat lisäksi olla substituoituja
ryhmällä, jossa on -O-C-sidos tai -O-Si-sidos, joka loh-
keaa pois hapon vaikutuksesta; R'₁ on esimerkiksi feny-
leeni, naftyleeni, difenyleeni tai oksidifenyleeni, jol-
loin kaikki nämä radikaalit ovat substituimattomia tai
substituoituja, R₂ on halogeeni tai C₁-C₁₀-haloalkyyli, R₃
on esimerkiksi C₁-C₁₀-alkyylisulfonyyli, fenyylisulfonyy-
li, naftyylisulfonyyli, antrasyylisulfonyyli tai fenant-
ryylisulfonyyli, joissa ryhmät ovat substituimattomia

Jatkuu seur. sivulla
Forts. nästa sida